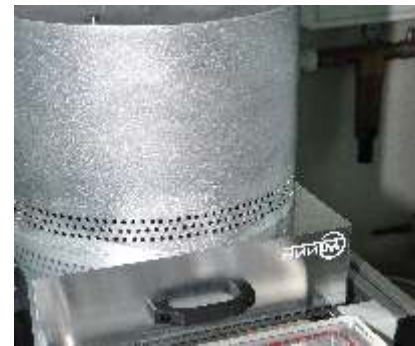




## ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНОК МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ

### МАГНА ТМ 7

**Назначение:** Нанесение пленок металлов, резистивных материалов и диэлектриков на подложки (пластины) методом магнетронного распыления.



#### Особенности:

- Групповая обработка подложек в одном технологическом цикле (односторонняя обработка): 60x48мм – 17 шт.;
- Количество МРУ в установке – 2 шт.;
- Нагрев подложек до 300° С (контроль в процессе);
- Контроль толщины резистивной пленки по сопротивлению в процессе;
- Количество ионных источников – 1 шт.;
- Безмасляная система откачки;
- Микропроцессорная система управления;
- Мощность потребления не более 9 кВт.

